**7 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО ТРАВЛЕНИЮ МОНОКРИСТАЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ В КОМБИНИРОВАННОМ РАЗРЯДЕ**

Плазмохимическое травление (ПХТ), является стандартным вариантом сухого изотропного травления. Данный вид травления представляет особый интерес, так как обладает такими свойствами как: [https://vunivere.ru/work68719]

– Селективность;

– Равномерность;

– Скорость;

– Не требует очистки поверхности после обработки;

– Позволяет одновременно травить подложки и удалять фоторезистивные маски;

– Может использоваться для обработки любых материалов;

Таблица 7.1 – Исходные данные для травления моно-Si в комбинированном, ВЧ, СВЧ разрядах

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Время, мин | Давление, Па | НЧ | | | Мощность СВЧ, Вт |
| Режим НЧ, (имп./непр.) | Частота, кГц | Мощность, Вт |
| 1 | 1 | 20 | имп | 32 | 80 |  |
| 2 | 1 | 20 | имп | 32 | 80 | 130 |
| 3 | 1 | 20 |  |  |  | 130 |
| 4 | 1 | 40 | имп | 32 | 75 |  |
| 5 | 1 | 40 | имп | 32 | 75 | 130 |
| 6 | 1 | 40 |  |  |  | 130 |
| 7 | 1 | 70 | имп | 32 | 75 |  |
| 8 | 1 | 70 | имп | 32 | 75 | 130 |
| 9 | 1 | 70 |  |  |  | 130 |

Таблица 7.2 – Данные измерение глубины металлизации до обработки

и глубины травления после обработки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Момент измерения | Измерения в 5 точках, (нм) | | | | | Среднее значение | Глубина травления | Скорость травления |
| Образец №1  НЧ | до, (нм) | 54 | 54 | 56 | 45 | 54 | 52,6 нм | 106 нм | 1,77 нм/с |
| после, (нм) | 171 | 130 | 158 | 169 | 165 | 158,6 нм |
| Образец №2  Комб | до, (нм) | 56 | 47 | 54 | 54 | 58 | 53,8 нм | 419,2 нм | 6,99 нм/с |
| после, (нм) | 513 | 470 | 456 | 453 | 473 | 473 нм |
| Образец №3  СВЧ | до, (нм) | 45 | 45 | 47 | 45 | 54 | 47,2 нм | 17,2 нм | 0,29 нм/с |
| после, (нм) | 64 | 75 | 63 | 57 | 63 | 64,4 нм |
| Образец №4(1)  НЧ | до, (нм) | 51 | 61 | 70 | 44 | 48 | 54,8 нм | 15,4 нм | 0,256 нм/с |
| после, (нм) | 54 | 58 | 84 | 81 | 74 | 70,2 нм |
| Образец №5(2)  Комб | до, (нм) | 65 | 45 | 49 | 37 | 54 | 50 нм | 8 нм | 0,133 нм/с |
| после, (нм) | 54 | 59 | 59 | 46 | 72 | 58 нм |
| Образец №6(3)  СВЧ | до, (нм) | 65 | 65 | 61 | 54 | 58 | 60,6 нм | 2,2 нм | 0,036 нм/с |
| после, (нм) | 63 | 56 | 65 | 65 | 65 | 62,8 нм |
| Образец №7(4)  НЧ | до, (нм) | 51 | 56 | 45 | 72 | 45 | 53,8 нм | 29,2 нм | 0,486 нм/с |
| после, (нм) | 93 | 81 | 81 | 90 | 70 | 83 нм |
| Образец №8(5)  Комб | до, (нм) | 45 | 37 | 36 | 45 | 36 | 39,8 нм | 149,2 | 2,486 нм/с |
| после, (нм) | 180 | 183 | 207 | 186 | 189 | 189 нм |
| Образец №9(6)  СВЧ | до, (нм) | 40 | 35 | 36 | 45 | 45 | 40,2 нм | 14,6 нм | 0,243 нм/с |
| после, (нм) | 63 | 47 | 61 | 52 | 51 | 54,8 нм |